BAB I
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan pengujian pada alat wafer cleaning pada fabrikasi IC ini dapat disimpulkan bahwa,

1. Alat ini dapat memonitoring suhu pada kompor yang digunakan dengan rata-rata akurasi sekitar 93,09% atau ± 4,23 °C serta memanaskan bahan kimia yang digunakan untuk proses pencucian wafer
2. Alat ini dapat mencuci wafer dengan kebersihan 73,3% dengan sisa kotoran yang menempel sekitar 26,7%.
3. Alat ini tidak dapat direalisasikan pada tingkat jual dan pada proses pencucian wafer yang dibutuhkan pada fabrikasi IC sebenarnya karena beberapa kekurangan dari alat ini.

1.2 Saran

Adapun saran yang diajukan agar dapat menjadi masukan untuk pengembangan alat wafer cleaning pada fabrikasi IC ini yaitu.

1. Terlepas kurang efektifnya pencucian menggunakan ala ini, maka penulis menyarankan untuk lebih membuat kefektifan dari alat ini, dari bentuk alat dan mekanika, serta sensor suhu yang lebih akurat.
2. Penulis menyarankan untuk menambahkan sensor untuk mendeteksi gelas yang akan merendam wafer.
3. Pada alat ini tidak disertakan penyemprot gas N_2 yang berfungsi untuk membersihkan bahan kimia yang menempel diakhir pencucian *wafer*, maka untuk pengembang disarankan untuk menambahkan penyemprot gas N_2.